

## OTFC1100 规格例



设备名称	OTFC-1100C/D
真空室	SUS304, $\phi$ 1100mm $\times$ 1520mm(H)
工件架	$\phi$ 950mm
工件架转速	5rpm to 50rpm(可变)
光学膜厚控制	Hom2-R-VIS350A 型光学控制 波长范围: 350nm to 1100nm 反射式/透射式
水晶式膜厚计	XTC/2+6 点式水晶传感器
蒸发源	电子枪 2 套
离子源	17cmRF 离子源
排气系统	机械泵+2 个扩散泵+Polycold (或 2 个冷凝泵)
<b>性能</b>	
达到压力	$7.0 \times 10^{-5}$ Pa 以下
排气时间	30 分 (大气压 $\sim$ $1.3 \times 10^{-3}$ Pa)
基板温度	最高: 350 $^{\circ}$ C
<b>工作条件</b>	
设备尺寸	约 5000mm(W) $\times$ 7000mm(D) $\times$ 3500mm(H)
电源	3 相,200v,50/60Hz, 约 85KVA
水流量	100 升/分以上
空气压力	0.5MPa 以上
重量	约 5500kg